

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年6月20日(20.06.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/128241 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01) H01L 21/68 (2006.01)
B25J 15/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/044560
- (22) 国際出願日: 2023年12月13日(13.12.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-201128 2022年12月16日(16.12.2022) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 山野 邊 北 斗 (YAMANOBÉ Hokuto); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 石川 翔

(ISHIKAWA Sho); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 洪 國維 (HONG Kuo-wei); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 谷澤 昭 尋 (YAZAWA Akihiro); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).

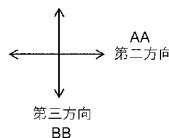
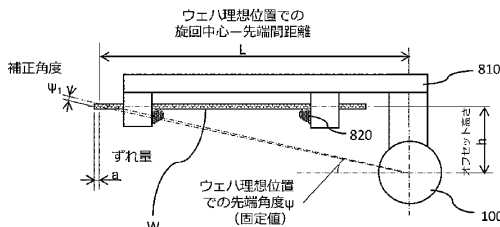
(74) 代理人: 大 野 聖 二, 外 (OHNO Seiji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号 丸の内北口ビル 2 1 階 大野 総合法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,

(54) Title: TRANSFER MACHINE AND SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 移載機及び基板処理装置

【図5】



a Amount of displacement
h Offset height
L Turning center-to-tip distance in ideal wafer position
 ψ Tip-angle (fixed value) in ideal wafer position
 ψ_1 Correction angle
AA Second direction
BB Third direction

(57) Abstract: A transfer machine 80 comprises: an arm 810; a holding unit 830 provided on the arm 810 to hold a substrate W; a turning unit 100 that turns the arm 810 about a turning axis A; and a control unit 50 that adjusts the position in an in-plane direction of the substrate W by turning the arm 810 by means of the turning unit 100 on the basis of the position, measured by a measuring unit 110, in the in-plane direction of the substrate W being held by the holding unit 830.

(57) 要約: 移載機 80 は、アーム 810 と、前記アーム 810 に設けられ、基板 W を保持するための保持部 830 と、回転軸 A を中心として前記アーム 810 を回転させる回転部 100 と、測定部 110 によって測定された前記保持部 830 で保持されている前記基板 W の面内方向の位置に基づいて、前記回転部 100 によって前記アーム 810 を回転させることで、前記基板 W の面内方向の位置を調整する制御部 50 と、を有する。

〔続葉有〕

WO 2024/128241 A1

KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))